

水素発生—ガス容量法装置（金属Si分析）

JIS R 2011準拠



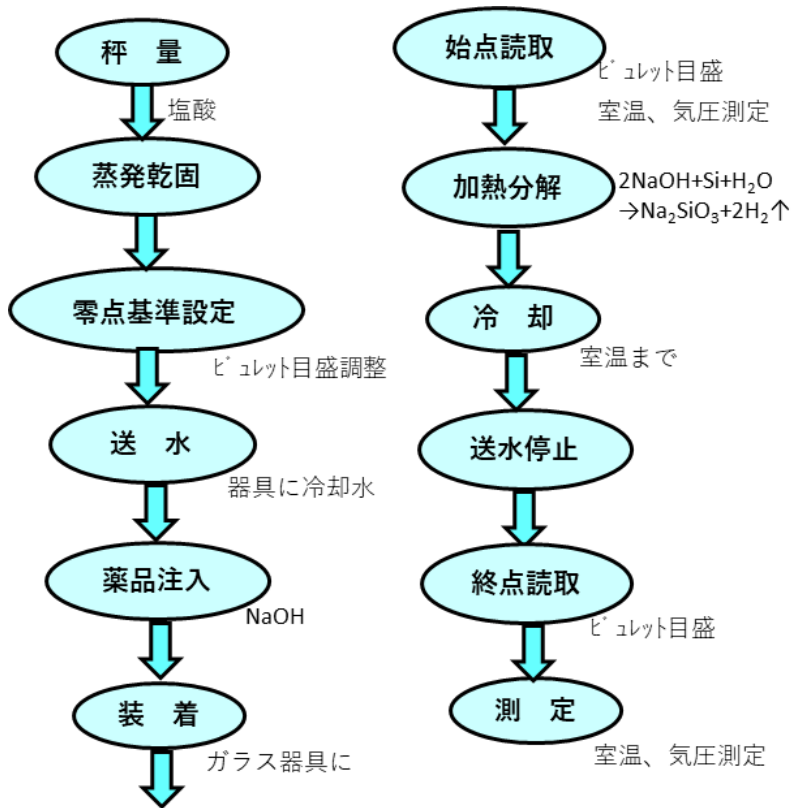
仕様	・ Si分析の定量範囲 0.1～10%
	・ 試験中の室温管理（±1℃以内）
	・ 使用器具 球管冷却器（400mL） 球部（180～200mL） ガスビュレット（100mL） 水準瓶（500mL）
用途	炭化珪素原料中の金属Si分析 耐火物中の金属Si分析

<原理>

試料に塩酸を加えて共存金属(Alなど)を分解後、NaOH添加、加熱によって生じる水素ガスをビュレットに捕集し、その体積を測定する。

（注）測定に当たっては、室温を±1℃以内に管理している。

<分析手順>



<計算>

$$\text{遊離 Si [\%]} = \frac{(V1 - V2) \times f \times 0.000627}{m} \times 100$$

V1: 始点と終点との目盛差
V2: 空試験のときの目盛差
f : 室温と大気圧に関する補正